

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 10 月 16 日 (16.10.2003)

PCT

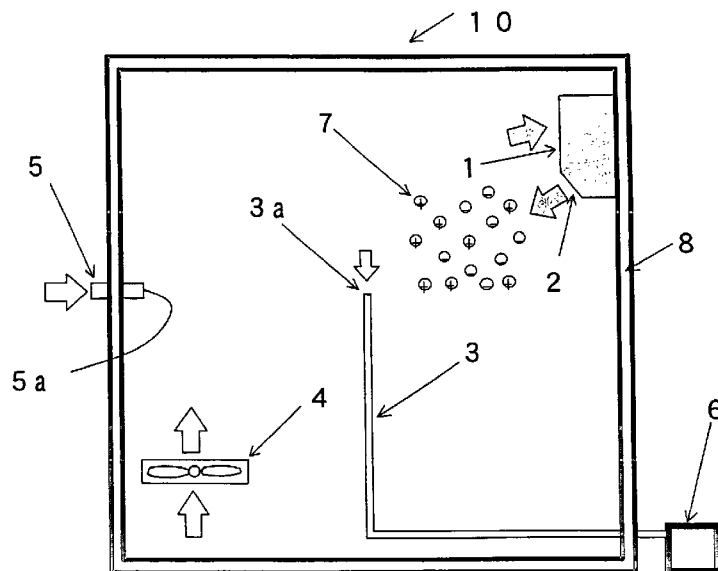
(10) 国際公開番号
WO 03/085126 A1

- (51) 国際特許分類⁷: C12M 1/34, A61L 9/18, 9/22 C12Q 1/04, (72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西川 和男 (NISHIKAWA, Kazuo) [JP/JP]; 〒545-0013 大阪府 大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内 Osaka (JP). 八木 久晴 (YAGI, Hisaharu) [JP/JP]; 〒545-0013 大阪府 大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内 Osaka (JP). 清水 善弘 (SHIMIZU, Yoshihiro) [JP/JP]; 〒545-0013 大阪府 大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内 Osaka (JP). 大谷 哲幸 (OHTANI, Tetsuyuki) [JP/JP]; 〒545-0013 大阪府 大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内 Osaka (JP). 野島 秀雄 (NOJIMA, Hideo) [JP/JP]; 〒545-0013 大阪府 大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内 Osaka (JP). 青木 正人 (AOKI, Masato) [JP/JP]; 〒228-0829 神奈川県 相模原市 北里 1 丁目 1 5 番 1 号 財団法人北里環境科学センター内 Kanagawa (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/IB03/01250
- (22) 国際出願日: 2003 年 4 月 7 日 (07.04.2003)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2002-104306 2002 年 4 月 5 日 (05.04.2002) JP
特願2002-326078 2002 年 11 月 8 日 (08.11.2002) JP
特願2003-102054 2003 年 4 月 4 日 (04.04.2003) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): シャープ株式会社 (SHARP CO., LTD.) [JP/JP]; 〒545-0013 大阪府 大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 Osaka (JP).

[続葉有]

(54) Title: METHOD OF ESTIMATING ELIMINATION OF MICROORGANISMS AND APPARATUS FOR ESTIMATING ELIMINATION OF MICROORGANISMS

(54) 発明の名称: 微生物の除去評価方法および微生物除去評価装置



(57) Abstract: It is intended to estimate the antimicrobial effect of a sterilization treatment whereby microorganisms are irradiated with particles. Microorganisms are introduced into the space in a container (8) and then irradiated with particles (7) for sterilization. After the completion of the irradiation with the particles (7), the microorganisms are collected into a collection container (6) and measured to thereby estimate the effect. The microorganisms to be sterilized may be one or more members selected from the group consisting of bacteria, fungi, viruses and allergens. As the particles, use can be made of cations, anions, a gas containing a mixture of cations with anions, charged particles such as α - and β -rays, various plasmatic gas ions, ozone and radical particles, drug particles and so on.

[続葉有]



WO 03/085126 A1



(74) 代理人: 大島 泰甫, 外(OHSHIMA, Yasutoshi et al.);
〒542-0081 大阪府 大阪市中央区 南船場 4 丁目 1 1 番
1 6 号 心斎橋コラムナービル 大島特許事務所 Osaka
(JP).

(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,
GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB,
BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO,
NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU,
ZA, ZM, ZW.

規則4.17に規定する申立て:

— すべての指定国のための不利にならない開示又は新
規性喪失の例外に関する申立て (規則4.17(v))

添付公開書類:

— 国際調査報告書

— 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する
申立て

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM,
AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許

2文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

微生物に粒子を照射して殺菌処理するにあたり、その殺菌効果を評価できる
ようにすることである。容器（８）の内部の空間に微生物を供給し、該微
生物を殺菌処理するための粒子（７）を照射し、該粒子（７）の照射を行っ
た後に採取器（６）により微生物を採取し、この採取された微生物を測定し
て評価を行う。殺菌処理の対象とする微生物を、細菌、真菌、ウイルスおよ
びアレルゲン物質よりなる群から選ばれた一または二以上の組み合わせと
することができる。粒子としては、正イオン、負イオン、および正負イオン
の混合したガスや、 α 線、 β 線などの荷電粒子や、各種プラズマ化したガス
粒子、オゾン、ラジカルなどの粒子、薬剤の粒子などを用いることができる。